

Halbleiter-Ptfe-Wafer-Carrier 8 Zoll Nassreinigung Hf-Beständig Ätzkassette

Artikelnummer: PL-CP82



Einführung

Optimieren Sie die Halbleiterverarbeitung mit diesem hochwertigen PTFE-8-Zoll-Wafer-Carrier, der für Hochreinigungs-Nassreinigungs- und HF-Ätzanwendungen konzipiert ist. Unsere industriellen Fluoropolymer-Kassetten gewährleisten maximale chemische Beständigkeit, überlegene Haltbarkeit und präzises Handling für empfindliche Reinraum-Produktionsumgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Silizium-Wafer-Ätzen	Handling von Wafern während der Entfernung von Opferschichten unter Verwendung von HF-basierter Chemie.	Vollständige Beständigkeit gegen Säureangriffe gewährleistet die Langlebigkeit des Carriers.
RCA-Reinigungsprozess	Unterstützung von Wafern durch mehrere Stufen der Entfernung organischer und ionischer Verunreinigungen.	Materialreinheit verhindert die Rekontamination gereinigter Oberflächen.
CMP-Nachreinigung	Transport von Wafern durch Reinigungsbürsten und Chemikalienbäder nach der Planarisierung.	Geringe Partikelabgabe hält extrem niedrige Defektraten aufrecht.
Photoresist-Entfernung	Verwendung aggressiver Lösungsmittel zur Entfernung lichtempfindlicher Beschichtungen nach der Lithografie.	Chemische Trägheit verhindert Materialverschleiß in Lösungsmittelbädern.
Solarzellenfertigung	Unterstützung der großflächigen Substratverarbeitung in hochsauen Umgebungen für PV-Zellen.	Haltbarkeit bei der Großserienproduktion senkt die Austauschkosten.
MEMS-Fertigung	Verwaltung empfindlicher mikro-elektromechanischer Systeme während komplexer Nass-Freigabeschritte.	Präzise Schlitzausrichtung verhindert mechanische Schäden an Strukturen.
Analytische Probenahme	Verwendung des Carriers als Substrathalter für die hochreine Spurenmetallanalyse.	Ultra-niedrige Hintergrundwerte gewährleisten genaue Laborergebnisse.

Merkmalkategorie	Technische Details für PL-CP82
Produktidentifikation	PL-CP82 Serie Custom Wafer Carrier
Primäres Material	Hochreines Virgin PTFE (Polytetrafluorethylen)
Wafer-Größenkompatibilität	Standard 8-Zoll (200mm) / Vollständig anpassbare Durchmesser
Konfigurationstyp	Einzelwafer (individuell) oder Mehrfach-Schlitz verfügbar
Fertigungsmethode	100 % Präzisions-CNC-Bearbeitung (Keine Formrückstände)
Temperaturbereich	-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)
Chemische Kompatibilität	Universell (HF, HCl, H2SO4, KOH, Aceton, etc.)
Oberflächenrauheit	Anpassbar basierend auf spezifischen Reinraumanforderungen
Schlitzteilung / Tiefe	Angepasst an kundenspezifische Prozessparameter

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Merkmalskategorie	Technische Details für PL-CP82	
Griff/Schnittstelle	Benutzerdefinierte Roboter-Abnahmepunkte oder manuelle Griffoptionen	
Dimensionale Genauigkeit	Präzisionstoleranzkontrolle nach Industriestandards	